## OPTICAL PATH CONVERTER AND XOPTICAL PATH CONVERTING ARRAY

Patent Number:

JP7287104

Publication date:

1995-10-31

Inventor(s):

YAMAGUCHI SATORU; others: 02

Applicant(s):

NIPPON STEEL CORP

Requested Patent:

JP7287104

Application Number: JP19940103356 19940418

Priority Number(s):

IPC Classification:

G02B3/00

EC Classification:

Equivalents:

#### Abstract

PURPOSE: To provide an optical path converter which can rotate a flat light by 90 deg, and the optical path converting array which arrays plural flat lights arrayed in a broken-line shape in a ladder shape facilitate the

convergence thereof.

CONSTITUTION:A flat light is made incident on the optical path converter 1, which has a 1st gradient index lens part 2 and a 2nd gradient index lens 3 having the same focal length formed at a distance twice as large as the focal length, so that the long axis of the light slants at 45\$ to the center line of the linear gradient index lens part 2, and then the long axis and short satisfactory at the focal length formed at a distance twice as large as large as the focal length formed at a distance twice as large as the focal length formed at a distance twice as large as the focal length formed at a distance twice as large as large as the focal length formed at a distance twice as large as l formed by rotating the flat light by 90 deg.. This optical path converter 1 is slanted at 45 deg. to the array direction and respective flat lights of lights in the broken-line shape are rotated by 90 deg. and array in the ladder shape. Consequently, a multistripe array semiconductor laser light is converged with high efficiency and made narrow.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

庁内整理番号

(11)特許出願公開番号

# 特開平7-287104

(43)公開日 平成7年(1995)10月31日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup> G 0 2 B 3/00 識別記号

В

FΙ

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数2 FD (全 7 頁)

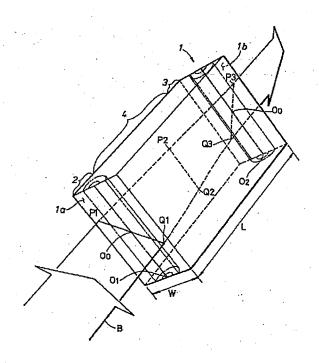
(21)出願番号	特顯平6-103356	(71) 出願人 000006655
		新日本製鐵株式会社
(22)出顧日	平成6年(1994)4月18日	東京都千代田区大手町2丁目6番3号
		(72)発明者 山口 哲
		相模原市淵野辺5-10-1 新日本製鐵株
		式会社エレクトロニクス研究所内
		(72)発明者 小林 哲郎
		東京都千代田区大手町2-6-3 新日本
	•	製鐵株式会社内
		(72)発明者 斉藤 吉正
		東京都千代田区大手町2-6-3 新日本
		製鐵株式会社内
		(74)代理人 弁理士 大島 陽一

### (54) 【発明の名称】 光路変換器及び光路変換アレイ

### (57)【要約】

【目的】 偏平な光を90°回転可能な光路変換器及び破線状に配列された複数の偏平な光を梯子状に配列してその集光を容易にする光路変換アレイを提供する。

【構成】 第1の分布屈折率レンズ部と、これと同じ焦点距離の第2の分布屈折率レンズ部とが焦点距離の2倍の距離だけ離間して形成させた光路変換器に対して、偏平光をその長軸が第1の一次元分布屈折率レンズ部の中央線に対して45° 傾くように入射することで、像の長軸と短軸とが反転し、即ち偏平光が90°回転したのと同様な像となる。この光路変換器を配列方向に対して45° 傾けて波線状の光線の各偏平光を90°回転させて梯子状に配列すれば、マルチストライプアレイ半導体レーザ光を高効率で集光し、かつ細く絞ることができる。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 偏平な透過光の光軸と直交する入射面上の第1の軸線を中心としてその近傍で屈折率が最も高く、該軸線から離間するにつれて漸減するように内部組成が徐々に変化してなる第1の分布屈折率レンズ部と、前記透過光の光軸と直交する出射面上に於ける前記第1の軸線と平行な第2の軸線を中心としてその近傍で屈折率が最も高く、該軸線から離間するにつれて漸減するように内部組成が徐々に変化してなり、かつ前記第1の分布屈折率レンズ部と同じ焦点距離の第2の分布屈折率レンズ部とが、前記各分布屈折率レンズ部の焦点距離の2倍の距離だけ互いに離間して形成された光学ガラス体からなり、

前記偏平な透過光を、その長軸が前記第1の軸線に対して45°傾くように前記入射面から入射し、前記第1及び第2の軸線を通る面を中心に像を反転させて前記透過光を光軸周りに90°回転させたのと等価な光を出射することを特徴とする光路変換器。

【請求項2】 偏平な透過光の光軸と直交する入射面上の第1の軸線を中心としてその近傍で屈折率が最も高く、該軸線から離間するにつれて漸減するように内部組成が徐々に変化してなる第1の分布屈折率レンズ部と、前記透過光の光軸と直交する出射面上に於ける前記第1の軸線と平行な第2の軸線を中心としてその近傍で屈折率が最も高く、該軸線から離間するにつれて漸減するように内部組成が徐々に変化してなり、かつ前記第1の分布屈折率レンズ部とが、前記各分布屈折率レンズ部の焦点距離の2倍の距離だけ互いに離間して形成された光学ガラス体からなる複数の光路変換器を、前記第1及び第2の軸線に対して45°傾く方向に配列し、

破線状をなす複数の前記偏平な透過光を、その長軸が前記第1の軸線に対して45°傾くように前記各光路変換器の入射面から入射し、前記第1及び第2の軸線を通る面を中心に像を反転させて梯子状に配列して出射することを特徴とする光路変換アレイ。

### 【発明の詳細な説明】

### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、透過光の形状を変換するための光路変換器及び光路変換アレイに関し、特に半導体レーザアレイを光源とする偏平な光の形状を変換するのに適した光路変換器及び光路変換アレイに関するものである。

### [0002]

【従来の技術】レーザ光を集光して光エネルギーを利用する技術の向上は、レーザ加工分野に於て最重要課題の一つである。通常のレーザ加工に用いられるレーザ発生器としては、YAGレーザが多用されている。しかしながらYAGレーザは、電気入力に対する光出力の変換効率が低く、比較的大規模な装置と多量の冷却水が必要で

ある。

【0003】一方、電気入力/光出力の変換効率が高く、かつコンパクトで大がかりな冷却装置を必要としないレーザ装置として、半導体レーザ素子を用いたものが知られている。また、比較的高出力が得られる半導体レーザ素子としては、マルチストライプアレイ半導体レーザが知られている。これは10本~100本のストライプ状活性層が半導体チップに刻まれており、1次元的に配列した10箇所~100箇所の線分状の各点からレーザ光が出射する破線状の光源を有している。

【0004】ところで、レーザ光は、レーザ加工分野のみならず、医療分野でも使用性の高いレーザ光源を提供する要望を満たす上からは、1本の光ファイバに高効率に導光できることが好ましい。このため、上記マルチストライプアレイ半導体レーザを用いる場合には、各活性層からの出射光をそれぞれ個別の光ファイバに導光してファイババンドルとし、これらの光ファイバ端面からの出射光を新たに集光するなどの措置がとられている。ところがこの場合、光ファイバのカプリング損失が大きい上、破線状に出射するレーザ光を単一の光ファイバに導光して細く高密度に絞ることが困難であった。

【0005】他方、半導体レーザ光を励起光源として用いた固体レーザが、高効率、長寿命、及び小型化を図れることから注目を集めている。この半導体レーザ励起固体レーザに於ける固体レーザの光軸方向から光励起する端面励起方式によると、固体レーザ発振のモード空間に半導体レーザ出力光による励起空間をマッチングさせることによって高効率な単一基本横モード発振を実現し得るが、例えば単レンズを用いてマルチストライプアレイ半導体レーザの光源の全長が約10m程もあるため、フォーカシング時にレンズの倍率で決まる径寸法のビームスポットしか得られず、端面励起方式の励起光源としてとして実用的な1m以下の径寸法のビームスポットを得ることは到底不可能であった。

【0006】そこで、図9に示すように、マイクロレンズアレイ31を用いてマルチストライプアレイ半導体レーザ素子の活性層21が出射するレーザ光をそれぞれ個別にコリメートした後、フォーカシングレンズ26を用いてビームスポットBSを一箇所に絞って全ストライプ光を重畳させる方法がある。この方法によれば、マイクロレンズ31とフォーカシングレンズ26との焦点距離で決まる倍率を各活性層21の全幅に掛け合わせた程度のビームスポット径が得られ、マルチストライプアレイ半導体レーザ発生素子の活性層21に対して垂直成分は細く絞ることができるが、隣合ったストライプ光に対応する各マイクロレンズを、半導体レーザ発生素子の出射面に近接配置する必要があるため、各マイクロレンズに焦点距離の短いものを使う必要があり、フォーカシンに焦点距離の短いものを使う必要があり、フォーカシン

グレンズとの組合せで決まる倍率が大きくならざるを得ず、実用的な集束スポット径にするには至らない。 【0007】

【0008】上記したように垂直成分 Ø Vは容易に絞る ことができることから、絞った後にレーザ光の垂直成分 θVと平行成分θIIとを入れ替えて各ビームが梯子状に配 列されれば、平行成分θHも容易に絞れ、全体として容 易に集光することができる。即ち、まず焦点距離の短い マイクロシリンドリカルレンズアレイを用いて活性層2 1の延在方向に垂直な成分θ Vを集光し、次いで垂直成 分θVと平行成分θHとを入れ替えて焦点距離の長いシリ ンドリカルレンズを用いて平行成分θHを集光する。最 後にフォーカシングレンズを用いて両成分をビームスポ ットに集束させる。ここで垂直成分については、マイク ロシリンドリカルレンズを光源に近接配置するので、倍 率は高くなるものの、光源の幅が極めて狭いために集束 スポット径はさほど大きくならない。また平行成分につ いては、シリンドリカルレンズを光源から離間配置する ので、倍率を小さく抑えることができるために集束スポ ット径を小さくすることができる。

【0009】本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、その第1の目的は、半導体レーザ活性層に対して平行な成分を集光するに際し、コリメータレンズを光源から離間して配置し、フォーカシングレンズとの組合せで決まる倍率を小さくすることによって絞ったビームスポット径を小さくすることのできる光路変換器を提供することにある。これに加えて本発明の第2の目的は、マルチストライプアレイ半導体レーザ素子から出射される放射角が大きい多数のレーザビームを集光して単一のスポットに絞り込み、レーザ加工用光源として使用したり、光ファイバに導光したり、固体レーザ発振のモード空間に半導体レーザ出力光による励起空間をマッチングしたりすることができるように、固体レーザ基本波を高効率に生起可能な光路変換アレイを提供することにある。

[0010]

【課題を解決するための手段】このような目的は、本発

明によれば、偏平な透過光の光軸と直交する入射面上の 第1の軸線を中心としてその近傍で屈折率が最も高く、 該軸線から離間するにつれて漸減するように内部組成が 徐々に変化してなる第1の分布屈折率レンズ部と、前記 透過光の光軸と直交する出射面上に於ける前記第1の軸 線と平行な第2の軸線を中心としてその近傍で屈折率が 最も高く、該軸線から離間するにつれて漸減するように 内部組成が徐々に変化してなり、かつ前記第1の分布屈 折率レンズ部と同じ焦点距離の第2の分布屈折率レンズ 部とが、前記各分布屈折率レンズ部の焦点距離の2倍の 距離だけ互いに離間して形成された光学ガラス体からな り、前記偏平な透過光を、その長軸が前記第1の軸線に 対して45°傾くように前記入射面から入射し、前記第 1及び第2の軸線を通る面を中心に像を反転させて前記 透過光を光軸周りに90°回転させたのと等価な光を出 射することを特徴とする光路変換器、及び偏平な透過光 の光軸と直交する入射面上の第1の軸線を中心としてそ の近傍で屈折率が最も高く、該軸線から離間するにつれ て漸減するように内部組成が徐々に変化してなる第1の 分布屈折率レンズ部と、前記透過光の光軸と直交する出 射面上に於ける前記第1の軸線と平行な第2の軸線を中 心としてその近傍で屈折率が最も高く、該軸線から離間 するにつれて漸減するように内部組成が徐々に変化して なり、かつ前記第1の分布屈折率レンズ部と同じ焦点距 離の第2の分布屈折率レンズ部とが、前記各分布屈折率 レンズ部の焦点距離の2倍の距離だけ互いに離間して形 成された光学ガラス体からなる複数の光路変換器を、前 記第1及び第2の軸線に対して45°傾く方向に配列 し、破線状をなす複数の前記偏平な透過光を、その長軸 が前記第1の軸線に対して45°傾くように前記各光路 変換器の入射面から入射し、前記第1及び第2の軸線を 通る面を中心に像を反転させて梯子状に配列して出射す ることを特徴とする光路変換アレイを提供することによ って達成される。

#### [0011]

【作用】本発明の光路変換器によれば、入射した偏平光は、第1の分布屈折率レンズ部でその入射位置の屈折率に応じて曲げられ、全体としてレンズの中心線を中心に反転して、丁度偏平方向が90°回転したねじれの状態で第2の分布屈折率レンズ部から出射する。即ち、各分布屈折率レンズ部はシリンドリカルレンズとして機能すると共に各レンズ部同士の位置関係の調整が別々のレンズを組み合わせた場合に比較して容易になる。また、複数の上記光路変換器を45°傾けて配列し、これらに破線状に直列する線状光を通過させれば、梯子状に並列した光に変換される。これにより、マルチストライプアレイ半導体レーザ素子からの出射光を、まず垂直成分を集光して破線状に直列する線状光とし、更に梯子状に並列した光に変換した後、平行成分をコリメートする構成とすれば、レーザ素子とコリメートレンズとの間の光学距

離を長くとっても、隣同士のストライプ光が重なり合う ことがなく、マルチストライプアレイ半導体レーザ光を 重畳させて微小なスポットに絞り込むことができる。 【0012】

【実施例】以下に添付の図面に示された具体的な実施例 に基づいて本発明を詳細に説明する。

【0013】まず、本発明の光路変換器の光路変換原理について説明する。図1は本発明が適用された光路変換器1の斜視図、図2(a)は、図1に示す光路変換器1の側面図、図2(b)は図2(a)の光路変換器1の正面図である。この光路変換器1は、一端面を入射面1aとし、他端面を出射面1bとする平板状の光学ガラス体からなる。

【0014】この光路変換器1の入射面1a側には、屈 折率の一次元的な分布が入射面1 a の厚さW方向の中央 線(第1の軸線) 01で最も高く、この中央線01から離 間するにつれて漸減するようになっている第1の分布屈 折率レンズ部2が形成されている。また、光路変換器1 の出射面1 b側には、上記第1の分布屈折率レンズ部2 と同様に、屈折率の一次元的な分布が出射面 1 b の厚さ W方向の中央線(第2の軸線)O2で最も高く、この中 央線O2から離間するにつれて漸減するようになってい る第2の分布屈折率レンズ部3が形成されている。これ ら第1の分布屈折率レンズ部2と第2の分布屈折率レン ズ部3との間の中間部4は均一な屈折率となっている。 尚、光路変換器1の長さ(L)は、各分布屈折率レンズ 部2、3の屈折率分布特性との相関に応じて、入射光が 各中央線OI、Ozを通る面を中心に丁度反転して同じ大 きさの像として出射するように、各分布屈折率レンズ部 2、3の焦点距離の2倍程度に設定されている。

【0015】 ここで、図2(a) に於ける右方の入射面 1 aから入射した光線 a・b・d・eは、それぞれが通る部分の屈折率の差に応じて光路変換器 1 内を進み、 a'・b'・d'・e'となって左方の出射面 1 b から出射する。また中央に入射した光線 c は、光路変換器 1 内を中央面に沿って直進し、c'となって出射する。即ち、互いに焦点距離の等しい第 1 の分布屈折率レンズ部 2 と第 2 の分布屈折率レンズ部 3 とを焦点距離の 2 倍だけ離して配置することにより、等倍の反転した像が得られる。

【0016】一方、この光路変換器1の入射面1aには、該入射面と直交する方向から偏平な光(半導体レーザ素子からの出射光)Bが入射し、その光軸は入射面1aの中心〇0を通るように、また偏平光Bの長軸が上記厚さW方向の中央線〇1、〇2に対して45°傾くように設定される。すると、入射面1aから入射面1aに入射した偏平光Bは、その断面を線分P1Q1で表すと、第1の分布屈折率レンズ部2で屈折して光路変換器1内の中間部で焦点を結び(線分P2Q2)、反転して第2の分布屈折率レンズ部3に至る。そして、この第2の分布屈折

率レンズ部3で屈折して出射面1bから出射し(線分P3Q3)、元の方向に進む。ここで、入射面1aと偏平光Bの光軸とが直交し、かつ偏平光Bの長軸が中央線Oiに対して45°傾いていることから、偏平光Bが各中央線Oi、Ozを通る面を中心に対称に反転すると、偏平光Bが光軸を中心に90°回転した状態と同様になる。

【0017】尚、上記したような各分布屈折率レンズ部を形成するには、例えば板状のガラス体の上記中央線O1、O2の部分のみにスリットを設けてNa+イオンをAg+イオンに置換し、イオン拡散分布を利用して屈折率分布を形成すれば良い。これを第1及び第2の分布屈折率レンズ部2、3に同時に行えば、容易に同様な光学的特性を有する2つの分布屈折率レンズ部を形成することができ、かつそれらの位置関係の調整を別途行う必要がない。

【0018】上記した光路変換器 1 を複数配列してマルチストライプアレイ半導体レーザ素子からの出射光を処理する光路変換アレイ 5 を図 3 に示す。ここで、マルチストライプアレイ半導体レーザ素子 2 2 は、活性層 2 1 の発光端面が破線状に配列しており(図 1 0 参照)、これら各活性層 2 1 の発光端面から出射した光の垂直成分  $\theta$  Vをシリンドリカルレンズまたはを用いて集光させて破線状の偏平光が入射するものとする。各光路変換器 1 は上記各偏平光の光軸に入射面 1 a が直交し、かつ偏平光の長軸と入射面 1 a の中央線  $\theta$  1 とが 4 5 で 傾くように、即ち配列方向と入射面 1 a の中央線  $\theta$  2 に、即ち配列方向と入射面 1 a の中央線  $\theta$  2 に、即ち配列方向と入射面 1 なの中央線  $\theta$  2 に、即ち配列方向と入射面 1 なの中央線  $\theta$  2 に で 回転させ、即ち、レーザ光の垂直成分  $\theta$  2 と水平成分  $\theta$  6 トとを入れ替えて様子状に配列させて出射するようになっている。

【0019】このようにして、一直線上に破線状に直列した多数のストライプ光B1は、光路変換アレイ4により、見かけ上梯子状に並列したストライプ光B2に変換される。

【0020】上記の構成に於ては、一つのストライプ光 に対して一つの光路変換器1を対応させている。従っ て、幅寸法が小さな活性層を多数配列したものに対して は光路変換器として極めて小さなものを用意しなければ ならないことになる。しかしながら実用上は、複数のス トライプ光に対して一つの光路変換器を対応させても良 い。この場合は、隣接する光路変換器の配列ピッチと同 一幅に多数のストライプを分割し、分割した要素毎に9 0 度回転することになるが、この場合でも、光路変換器 の配列ピッチと同程度にレーザ光を絞ることができる。 【0021】上記光路変換器を用い、例えば200μm 幅の活性層21を800μmピッチで12本配列してな るマルチストライプアレイ半導体レーザ素子22が出射 するレーザ光を集光する半導体レーザ集光装置23を図 4に示す。図4に於て、マルチストライプアレイ半導体 レーザ素子22に近接配置した円柱レンズ24によって

活性層 21に対する垂直成分をコリメートした後、各活性層 21に対応して光路変換器 1 (各変換器が配列面に対して 45°で傾斜) を  $800\mu$  mピッチで配列した光路変換アレイ 5により、各ストライプ光の断面の長軸と短軸とを反転させる。

【0022】次いで光路変換アレイ5からの出射光を集 光するように配置されたシリンドリカルレンズ25によって活性層と平行な成分をコリメートする。そして最後 にフォーカシングレンズ26を用いてレーザ光を絞り込む。これにより、焦点の位置に複数のストライプ光が重 畳したビームスポットBSを得る。

【0023】 このようにして、フォーカシングレンズ26とビームスポットBSとの間の距離と、マルチストライプアレイ半導体レーザ素子22とシリンドリカルレンズ25との間の距離との比を小さくとれるので、極めて小さな径(直径 $400\mu$ m)に集光されたビームスポットBSが得られる。尚、垂直成分については、フォーカシングレンズ26とビームスポットBSとの間の距離と、マルチストライプアレイ半導体レーザ素子22と円柱レンズ24との間の距離との比が大きくなるものの、光源の幅が十分に小さいため、絞られたビームスポット径は大きくならない。

【0024】上記円柱レンズに代えて、円柱レンズと同等の働きをするシリンドリカルレンズを用いても良いことは云うまでもない。

【0025】上記半導体レーザ集光装置を用いて集光したレーザ光を光ファイバ(コア径400  $\mu$  m)に導光することもでき、図5に示すように、フォーカシングレンズ26にて集光したレーザ光を光ファイバ27に導光すると、10Wの半導体レーザ出力のうち60%の導光効率が得られる。

【0026】また、上記半導体レーザ集光装置にて集光したレーザ光を用いて固体レーザを光励起することもでき、図6に示すように、フォーカシングレンズ26にて集光したレーザ光にてYAGレーザなどの固体レーザ素子28の端面励起による光励起を試みると、10Wの半導体レーザを用いて3WのYAGレーザ出力が得られる。

【0027】更に、図7に示すように、フォーカシングレンズ26にて集光したレーザ光を光ファイバ27に導光した上で固体レーザ素子28を端面励起により光励起すると、2WのYAGレーザ出力が得られる。

#### [0028]

【発明の効果】このように本発明によれば、第1の分布 屈折率レンズ部と、これと同じ焦点距離の第2の分布屈 折率レンズ部とが焦点距離の2倍の距離だけ離間して形 成させた光路変換器に対して、偏平光をその長軸が第1 の分布屈折率レンズ部の中央線に対して45°傾くよう に入射することで、像の長軸と短軸とが反転し、即ち偏 平光が90°回転したのと同様な像となる。このとき、

各分布屈折率レンズ部はシリンドリカルレンズとして機 能すると共に各レンズ部同士の位置関係の調整が別々の レンズを組み合わせた場合に比較して容易になる。この 光路変換器を配列方向に対して45°傾けて波線状の光 線の各偏平光を90°回転させて梯子状に配列すれば、 大出力のマルチストライプアレイ半導体レーザ光を高効 率で集光し、かつ細く絞ることができるので、パワー密 度の高いビームスポットを得ることができる。これによ り、レーザ加工やレーザはんだ付けに於て特に精密な加 工を実現することが可能となる。また、集光したマルチ ストライプアレイ半導体レーザ光を光ファイバに導光す るように構成すれば、レーザ光の取扱い性が高められ る。さらに、上記構成を有する半導体レーザ励起固体レ ーザによれば、従来のアレイ半導体レーザでは困難であ った端面励起が可能となり、効率並びにビーム品質の高 い固体レーザを実現することができる。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明が適用された光路変換器の構成及び光路 変換の様子を示す模式的斜視図。

【図2】(a)部及び(b)部は、図1の光路変換器の 光路変換の原理を説明するための側面図及び正面図。

【図3】本発明が適用された光路変換アレイとマルチストライプアレイ半導体レーザ光との対応図。

【図4】本発明が適用されたレーザ装置の構成を示す模式的側面図。

【図5】本発明が適用されたレーザ装置の構成を示す模式的側面図。

【図6】本発明が適用されたレーザ装置の構成を示す模式的側面図。

【図7】本発明が適用されたレーザ装置の構成を示す模式的側面図。

【図8】(a)部及び(b)部は、従来の破線状に配列したマルチストライプアレイ半導体レーザの集光状態を説明する平面図及び側面図。

【図9】マルチストライプアレイ半導体レーザ素子と各 活性層からの出射光パターンを示す模式的斜視図。

### 【符号の説明】

- 1 光路変換器
- 1 a 入射面
- 1 b 出射面
- 2 第1の分布屈折率レンズ部
- 3 第2の分布屈折率レンズ部
- 4 中間部
- 5 光路変換アレイ
- 21 活性層
- 22 マルチストライプアレイ半導体レーザ素子
- 24 円柱レンズ
- 25 シリンドリカルレンズ
- 26 フォーカシングレンズ
- 27 光ファイバ

28 固体レーザ素子

29 共振器出力鏡

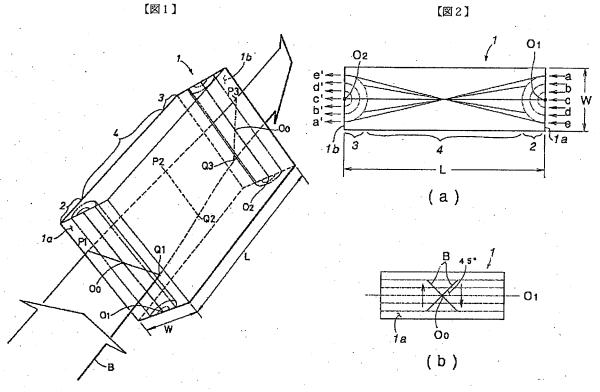
30 レンズ

31 マイクロレンズ

Oı 第1の軸線

Oz 第2の軸線

【図1】



【図3】

